(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2006 年8 月24 日 (24.08.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/088022 A1

(51) 国際特許分類:
B01J 35/02 (2006.01) *C09D 185/00* (2006.01)
B01J 21/08 (2006.01) *C09D 201/00* (2006.01)
B01J 37/08 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/302542

(22) 国際出願日: 2006 年2 月14 日 (14.02.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2005-037763 2005 年2 月15 日 (15.02.2005) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三井化学株式会社 (MITSUI CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒1057117 東京都港区東新橋一丁目５番２号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宮添 智 (MIYAZOE, Satoru) [JP/JP]; 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦５８０－３２ 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 鍋田 貴司 (NABETA, Takashi) [JP/JP]; 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦５８０－３２ 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 堀内 伸彦 (HORIUCHI, Nobuhiko) [JP/JP]; 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦５８０－３２ 三井化学株式会社内 Chiba (JP).

(74) 代理人: 速水 進治, 外 (HAYAMI, Shinji et al.); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西２－１７－１６ 代官山ＴＫビル１階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

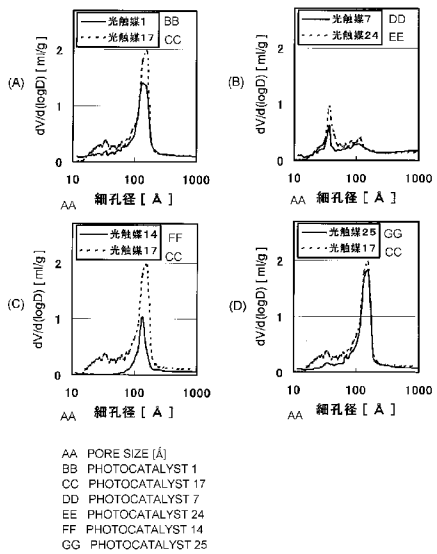
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) **Title:** PHOTOCATALYST, METHOD FOR PRODUCING SAME, LIQUID DISPERSION CONTAINING PHOTOCATALYST AND PHOTOCATALYST COATING COMPOSITION

(54) 発明の名称: 光触媒、その製造方法、光触媒を含有する分散液および光触媒塗料組成物



(57) **Abstract:** Disclosed is a photocatalyst comprising a photocatalytically active base and a silicon oxide film covering the base and substantially having no pores. The alkali metal content of the photocatalyst is not less than 1 ppm but not more than 1000 ppm. Also disclosed is a method for producing such a photocatalyst wherein when a photocatalytically active base present in an aqueous medium is coated with a silicon oxide film by using a silicate, the pH of the aqueous medium containing both the photocatalytically active base and the silicate is maintained at 5 or below.

[続葉有]

WO 2006/088022 A1

(57) 要約:

本発明によれば、光触媒活性を有する基体と、該基体を被覆する、実質的に細孔を有しない酸化珪素膜とを有し、アルカリ金属含有量が１ｐｐｍ以上１０００ｐｐｍ以下である光触媒が提供される。

また本発明によれば、上記光触媒の製造方法として、水系媒体中に存在させた光触媒活性を有する基体に、珪酸塩を用いて酸化珪素膜を被覆する際、光触媒活性を有する基体と珪酸塩の両方を含む水系媒体のｐＨを５以下に維持する光触媒の製造方法が提供される。